# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-049202

(43) Date of publication of application: 22.02.1994

(51)Int.CI.

C08G 65/48 C08G 65/40

C25B 13/08

(21)Application number: 05-140894

(71)Applicant: HOECHST AG

(22)Date of filing:

11.06.1993

(72)Inventor: HELMER-METZMANN FREDDY

OSAN FRANK

(30)Priority

Priority number: 92 4219077

Priority date: 11.06.1992

Priority country: DE

# (54) POLYMER ELECTROLYTE AND ITS PREPARATION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a polymer electrolyte contg. a sulfonated arom. polyether ketone and useful for an ultrafiltration membrane, etc., by dissolving an arom. polyether ketone in sulfuric acid, adding a sulfonating agent to the resultant soln. and carrying out sulfonation. CONSTITUTION: An arom, polyether ketone of formula I (where Ar is a phenylene ring having p- and/or m-bonds; Ar' is phenylene, naphthylene, biphenylene or the like; X, M and N are each 0 or 1, Y is 0-3 and P is 1-4 with the exception of the combination of P=2, M=0, N=0 and Y=0 and the combination of P=1, M=1, X=0, Y=0 and N=0). preferably a compd. consisting of units of formula II and formula III and non-sulfonatable units of formula IV or formula V is dissolved in 94-97 wt.% sulfuric acid, a sulfonating agent is added to the resultant soln, until the concn. of sulfuric acid attains to 98-99.9 wt.% and a reaction mixture is immediately prepd. to obtain the objective polymer electrolyte contg. an arom. polyether ketone in which ≥20% of the O-phenylene-O units have been sulfonated.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

02.06.2000

[Date of sending the examiner's decision of

19.03.2002

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision 2002-10950

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 17.06.2002

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出組公開各号

## 特開平6-49202

(43)公開日 平成6年(1994)2月22日

(51)Int.CL<sup>5</sup> 識別記号 庁内整理番号 FΙ 技術表示箇所 C 0 8 G 65/48 NQU 9167-41 NQW 9167-4 J 65/40 C 2 5 B 13/08 301 8414-4K

審査請求 未請求 請求項の数14(全 10 頁)

(21)出顯各号	特與平5-140994	(71)出頃人	590000145
			ヘキスト・アクチェンゲゼルシャフト
(22)出戰日	平成5年(1993)6月11日		ドイツ迫邦共和国、フランクフルト・ア
			ム・マイン(番地無し)
(31)優先權主張番号	P4218077:0	(72)発明者	フレディ・ヘルマーーメッツマン
(32)優先日	1992年6月11日		ドイツ連邦共和国デーー6500 マインツ,
(33)優先権主張国	デイツ (DE)		ペーター・マイゼンベルガー・ヴェーク
			2
		(72)発明者	フランク・オサン
			ドイツ連邦共和国デーー6233 ケルクハイ
			ム/タウヌス、ハッテルスハイマー・シェ
			トラーセ 27-29
		(74)代理人	弁理士 湯浅 恭三 (外5名)

### (54) 【発明の名称】 高分子電解質及びその調製法

## (57)【要約】

【目的】 芳香族ポリエーテルケトンを迅速に且つ穏や かにスルホン化する方法を提供する。

\*【構成】 次式 【! で表されるようなスルホン化芳香族 ポリエーテルケトン

[{k1}

(式中、aは0.2 - 1であり、cは0 - 0.8で あり、且つ8+c=1である)のスルホン化芳香族ポリ エーテルケトンを含む高分子電解質。該高分子電解質 は、94 - 97重量%臓酸中に芳香族ポリエーテルケ

トンを溶かし、その溶液に、硫酸の濃度が98 - 9 9. 9重置%になるまで、発煙硫酸のようなスルホン化 剤を加えることによって調製する。

(式中、A dtパラ及び/又はメタ結合を有するフェニレン環であり、A r はフェニレン、ナフチレン、ピフェニレン、アンスリレン、又は他の二価芳香族単位であり、X、M、及びNはそれぞれ別個にりまたは1であり、Yは0、1、2、X0、X1、X1、X2、X3 であり、X4 であり、X2 はX3 により、X4 であり、X4 により、X4 により、X4 により、X5 により、X6 により、X7 により、X7 により、X7 により、X8 によりにはいる。X9 により、X9 により、X9 によりにはいる。X9 によりにはいる。

※及びP=1、M=1、X=0、Y=0 N=0 の組合せは除く)で表され、O-フェニレン-O単位の少なくとも20%がSO』H華で置換されている。スルホン化芳香族ポリエーテルケトンを含む高分子電解質。 【請求項2】 次式11

[(t2)

(式中、aは0.2 - 1であり、cは0 - 0.8であり、且つa+c = 1である)に従う請求項1記載の高分子電解質。 ★

★【請求項3】 次式!!! 【化3】

(式中、 a は 0 - 1 であり、 b は 0 - 1 であり、 c は 0 - 0.5 であり、且つ a + b + c = 1 である) に 従う請求項1記載の高分子電解質。

【請求項4】 次式 | で表される芳香族ポリエーテルケトンをスルホン化することによって高分子電解質を調製50 する方法であって、

(3)

特開平6-49202

94 - 97重置%確酸中に前記芳香族ポリエーテルケ トンを溶かす工程、

その得られた溶液に、硫酸の濃度が98 - 99.9重 置%になるまで、スルホン化剤を加える工程、及び壁ま\* \* しいスルホン化度に達したら直ぐに反応混合物を調製す る工程から成る。前記方法。

[(£4)

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} A & -O \end{bmatrix}_{A} & \begin{bmatrix} CO - A & T \end{bmatrix}_{X} & \begin{bmatrix} CO - A & T \end{bmatrix}_{Y} & \begin{bmatrix} CO - A & T \end{bmatrix}_{X} & \begin{bmatrix} CO - A$$

(式中、P、X、M、Y、N、Ar、及びAri は語求項 1と同様である)

※ニレンのみである請求項4記載の方法。 【請求項6】 次式!V、V、及びVI

【請求項5】 式!において、ラジカルAド は、フェ ※ [化5]

$$+ \left( \bigcirc - \circ \right)_{3} \left( \bigcirc - \stackrel{\circ}{\circ} \right)_{2}$$
 (v)

の少なくとも2つの異なる単位から構成されるコポリマ ーである芳香族ポリエーテルケトンを用いる請求項5記 載の方法。

【請求項7】 磁磁中で芳香族ポリエーテルケトンをス

ルボン化することによって高分子電解質を調製する方法 であって、

次式

[(£6]

又は

$$+-\left(\bigcirc \bigcirc \circ\right)_{2}\left(\bigcirc \bigcirc \circ\right)_{2}^{0}$$

で表される単位。及び非スルホン化性の単位から構成される芳香族ポリエーテルケトンを用いる工程。

94 - 97重量%硫酸中に芳香族ポリエーテルケトンを溶かす工程。

\* るまで、スルホン化剤を加える工程。及び望ましいスルホン化度に達したら直ちに反応復合物を調製する工程から成る前記方法。

【請求項8】 非スルホン化性の単位が次式VII 【化7】

その溶液に、磁酸の濃度が98 - 99.5重量%にな\*20

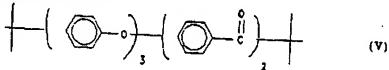
を有するような芳香族ポリエーテルケトンを用いる請求 ※ 【請求項9 】 非スルホン化性の単位が次式V I I ! 項7記載の方法。 ※ 【化8 】

を有するような芳香族ポリエーテルケトンを用いる請求 項7記載の方法。

【語求項10】 スルホン化剤を、発煙硫酸、クロロスルホン酸、及び三酸化硫黄から選択する請求項4又は7記載の方法。

★【請求項11】 溶液の温度を、スルホン化剤を加えた 後に、少なくとも50℃まで上昇させて、スルホン化を 加速する請求項4又は7記載の方法。

【請求項12】 次式 i V 【化9】



のポリマーを、温度25°Cで、94 - 96 宣量%硫酸 中に治かす請求項4記載の方法。 【請求項14】 次式VI 【化11】

のポリマーを、温度25 - 50℃で、95 - 96. 5重量%硫酸中に溶かし、温度60 - 90℃でスルホ ン化する請求項4記載の方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、スルホン化芳香族ポリ エーテルケトンを含む電解質と、前記高分子電解質を調 製する方法とに関するものである。

[0002]

【従来の技術】スルホン化ポリエーテルケトンは、陽イ オン交換体を形成する。それらは、多くの場合におい て、水の存在下でも、機械的に安定であるので、膜材料 として、例えば限外流過、脱塩、及び微生物除去のため の競材料として有用である。

【①①①3】スルホン化ポリエーテルケトンの調製法 は、欧州特許出願第08895号及び第041780号 に記載されている。欧州特許出願第8895号によれ ば、スルホン化すべきポリマーは、室温において、98 重量%硫酸中に影瀾される。溶解プロセスとスルホン化 は、同時に進行し、極めて钻鋼な溶液が徐々に得られ る。この溶液は、同じ温度において同じ濃度の確酸で希 釈されるか、又はそのままの状態にしておく。反応は、 極めてゆっくりと進行する。この特許出願明細書によれ ホン化するのに 10日間を要したということである。エ ーテル橋 対 CO橋 の数的割合は、用いられたエーテ ルケトン中において約2:1である。

【0004】欧州特許出願第41780号に記載されて いる方法によると、芳香族ポリエーテルケトン (実際に はコポリマー) は、高温でスルホン化される。モノマー 単位(A)のうちのほんの幾つかがスルホン化され、モ ノマー単位(B)は、全くスルホン化されない。 スルホ ン化度は、A対Bの割合によって調節することができ 中及びその後において、反応条件は、不変のままであ る。対応するホモボリマー(A)は、特定の条件下で、 極めて高度にスルホン化されて、水溶性化合物を与える と考えられる。この場合、スルホン化は、ポリマー溶解 プロセス中に起とるので、スルホン化度を調節して、ほ んのわずかにスルホン化された生成物を得ることは難し

【0005】上記方法においては、反応条件は、反応中 において、実際には変化しないので、かなりの割合のス 10 ルホン酸基を、溶解プロセス中においてさえも導入する ことができる。これらのスルホン化法には、穏やかな金 件下では反応が極めてゆっくり進行し、活発な条件下で は、純粋なスルホン化生成物が得にくい、という短所が ある。又、スルホン化剤及びスルホン化溶剤として濃硫 酸を用いる場合には、分解反応及び/又は架橋反応が、 ボリエーテルケトンの処理中に起こるという短所がある (欧州特許第08 895号)。

【0006】該方法中にポリエーテルケトンのスルホン 化度をモニターすることは、極めて重要である。調製し 20 た水性媒体からの生成物の単離は、スルホン化度が増大 すると共に益々難しくなる。ポリマー構造に従って、ス ルホン化生成物は、水中で生成し、あるスルホン化度に おいては、膜を製造するには不適当な高度に膨潤したゲ ル沈殿又は乳状沈殿が生起する。

[0007] Marvel 5 (Journal of Polymer Science. Polymer Chem. Vol.23、2205-2223、(1985)) は、クロ ロスルホン酸、又は 50g/トリエチルホスフェート錯体 を用いて、種々の(エーテル/ケトン)シーケンスをス ルホン化することを報告している。後者の系において は、スルホン化可能なフェニレン単位の約90%をスルー30 は、ポリマー主鎖に関して高度の分解並びに架橋が、観 察された。対照的に、クロロスルホン酸経路ではより好 しい結果を得たが、ここでもポリマー主鎖の分解は有意 な副反応であった。同様に、Bishop らによる研究(Mac romolecules、<u>18</u>、86-93(1985))でも、クロロスルホ ン酸を用いるポリエーテルケトンのスルホン化において 架橋反応が起こることが認められた。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は、芳香族ポリエーテルケトンを迅速に且つ穏やかにス る。しかしながら、この場合においても、溶解プロセス 40 ルホン化する方法を提供することにある。又、本方法に よって新規なスルホン化ポリエーテルケトンを得ること も本発明の目的である。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記の目的は、次式! 【化12】

9 (6) 特開平6-49202 
$$\frac{10}{10}$$
  $\frac{1}{10}$   $\frac{1}$   $\frac{1}{10}$   $\frac{1}{10}$   $\frac{1}{10}$   $\frac{1}{10}$   $\frac{1}{10}$   $\frac{1}{$ 

(式中、Artはパラ及び/又はメタ結合を有するフェニ レン環であり、Ar はフェニレン、ナフチレン、ビブ ェニレン、アンスリレン、又は他の二個芳香族単位であ り、X、M、及びNは、それぞれ別個にOまたは1であ り、YはO、1、2、又は3であり、Pは1、2、3、 又は4である)で表される芳香族ポリエーテルケトンを スルホン化する方法、及びその結果得られる高分子電解 質によって達成されることを見出した。この方法は、濃 度94-97重置%の硫酸中に芳香族ポリエーテルケ トンを溶かす工程、その得られた溶液に、硫酸の濃度が 98 - 99. 5重置%になるまで、スルホン化剤を加 える工程、及び望ましいスルホン化度に達したら直ちに 20 て、30時間後にはスルホン化度25%、及び遺度9 反応混合物を調製する工程、を含む。

【0010】式【の芳香族ポリエーテルケトンは、容易 に得ることができる。スルホン化に用いられる高分子芳 香族エーテルケトンは、原理的には、適当な芳香族ビス 酸ニハロゲン化物を芳香族エーテルと反応させるブリー デル・クラフツ求電子重縮合によって得ることができ る。この方法は、例えば、米国特許第3 065 205 号,英国特許第971 227号,米国特許第3 441 538号、英国特許第1387 303号、WO第84 -03 891号、及び Iwakura Y., Uno K., 及び Tah 30 rquchi T.J. による論文 Polym. Sci.、Pat.A-1、6、 3345 (1968) に記載されている。

【①①11】又、エーテルケトンは、水核芳香族面換に よって得ることができる。この目的のために、例えば: R.A. Clendinning, A.G. Farnham, W.F. Hall, R.N. Jo hnson、及び C.N. Merman による J. Polym. Sci. Al 5. 2375、(1967),英国特許第1 177 183号。 英国特許第1 141 421号、欧州特許第0 001 879号、米国特許第4 108 837号、米国特許第 4 175 175号、T.E. Artwood, A.B. Newton、J. B. Rose による Br. Polym、Journ.、4、391、(1972): T.E. Attwood, P.C. Davson, J.L. Freemann, L.R.J. H oy、J.B. Rose、P.A. Staniland による Polymer、22、 1996、(1981) に記載されているように、対応する芳香 族ピスジオールを、芳香族ジハロゲン化ケトンと反応さ

[0012]P=1, X=1, M=1, Y=0, N=0のボリマーはピクトレックス (Victrex、登録商標) と いう商品名で市販されている。N=1又はY=3又はP

って調製することができる。芳香族ポリエーテルケトン 10 は、好ましくは、穏やかな条件下で、即ちスルホン化が 十分に抑制されるか又は差し当たって起こらない条件下 で確酸中に溶かす。様々な溶解条件下において、式!V で表されるホモボリマーをスルホン化する場合のスルホ ン化度に関する詳細は、X. Jin、M.T. Bishop、T.S. El lis、及び F.E.Karasz による British Polymer Journa 1、Vol. 17、(1985)、p. 4-10 に記載されている。これ ちの著者によると、濃度94%硫酸中25℃において、 75時間後にはスルホン化度は4%であった。本発 明者らの研究によると、濃度95%韓酸中25°Cにおい 6.2%硫酸中において、24時間後にはスルホン化度 32%が観察された。これらのポリマーに関する好まし い溶解条件は、最大スルホン化度が35%となるような 多件である。

【①①13】式Viのホモポリマーに関して、本発明者 らの研究によると、濃度95%又は96.2%離骸中2 5°Cにおいて、5時間後にはスルホン化度は14%にな ることが観察されている。従って、確酸の濃度は、この 場合、重要ではない。このポリマーに関する好ましい窓 解条件は、最大スルホン化度が15%となるような条件 である。

【①①14】スルホン化されるべきポリマーの好ましい 全ての二価芳香族ラジカルAriは、フェニレンラジカル であり、好ましくは1、4-フェニレンラジカルであ る。硫酸の濃度を増加させるのに役立ち且つスルホン化 に役立つ好ましいスルホン化剤は、発煙硫酸、クロロス ルホン酸、又は三酸化硫黄である。

【①①15】溶解に用いられる硫酸の遺度は、好ましく は、96 - 96.5%である。溶解温度は、エーテル 40 締 対 カルボニル橋 の数的割合によって左右される。 カルボニル基に比べて、エーテル基の割合が増大する と、求電子置換(例えば、スルホン化)のためのポリエ ーテルケトン主鎖の反応性も増大する。導入することが できるスルホン酸基の数は、酸素原子によって架橋され ている芳香環の数によって左右される。〇ーフェニルー ○ 単位のみが、特定の条件下でスルホン化され、一方 O-フェニル-CO 基は、スルホン化されないままで ある。ポリマーの溶解中の温度は、一般的には、10 - 60℃であり、特に20 - 60℃であり、好まし =4又はX=1のポリマーは、好ましくは、求核法によ 50 くは30 - 50℃である。この溶解プロセス中におい

(7)

特開平6-49202

ては、主鎖のスルホン化は、十分に抑制される。本発明 者らが行ったNMRによる測定では、スルホン化中に分 解は超こっていないことが分かった。

【りり16】試料を完全に溶かした後、例えば発煙硫酸 を加えることによって、H.SO、濃度を、98 - 99. 9重量%、特に98 - 99.5重量%、好きしくは9 8.2 - 99.5宣置%になるまで上昇させる。実際 のスルホン化における反応温度は、溶解プロセスにおけ るそれに比べて高くてもよい。スルホン化は、一般的に は、10 - 100℃、特に30 - 90℃、好ましく 10 り、且つ次式 I V、V、又はV! は30 - 80℃で行う。温度を上昇させることによっ て、且つ反応時間を長くすることによって、ポリマーの\*

\*スルホン化度は増大する。一般的な反応時間は、0.5 - 10時間、特に1- 8時間、好ましくは1.5 -3時間である。反応時間が、10時間を超えると、ス ルホン化度は、ほんのわずかしか増大しない。スルホン **化剤を加えた後、溶液の温度を少なくとも50℃まで上** 昇させると、スルホン化が、かなり加速される。

【0017】好ましくは、式!V、V、又はVIで表さ れるホモボリマーをスルホン化する。本発明の更なる改 良に従って、既に述べた方法を用いて、コポリマーであ 【化13】

$$+\left(\bigcirc -c\right)_{3}\left(\bigcirc -\frac{c}{c}\right)_{2}$$
(v)

で表される少なくとも2つの異なる単位から構成される。30%で用いようとする場合には望ましくない。なぜならば、 芳香族ポリエーテルケトンをスルホン化する。

【①①18】本発明に従う方法の更に好ましい態様は、 式V又はVIで表される単位、及び非スルホン化性の単 位から構成されるポリエーテルケトンを用いることであ る。式! Vで表されるモノマー単位と、非スルホン化性 のエーテルケトン単位とのコポリマーをスルホン化する ことは、欧州特許出願第41780号及び欧州特許第0 8895号に記載されている。同じ条件下で、式 I Vで 表されるホモボリマーを完全にスルホン化すると、窒温 果単離するのが極めて難しい完全に水溶性の生成物が生 じると考えられる。これらの特性は、例えば電気分解セ ル中においてポリスルホン酸を親水性イオン交換膜とし※ 高度に膨調すると、膜の機械的強度が失われるからであ る。一方では、特に、高いイオン交換容置を実現するた

めには、高度のスルホン化が必要である。

【0019】本発明の方法においても、ポリエーテルケ トンは、94 - 97重量%硫酸中に溶かす。その溶液 に、確敵の滅度が98 - 99.5重量%になるまで、 スルホン化剤を加える。望ましい程度のスルホン化が達 成されたら直ぐに、反応混合物を調製する。

【①020】非スルホン化性の単位は、好ましくは、4 の水中において、極めて高度な膨瀕性能を有し、その結 40 -ヒドロキシベンゾフェノンから正式に誘導される次式 VII

[(14]

【化15】

を有するか、又は4-ヒドロフェニルスルホンから誘導 される次式VIII

を有する。

【0021】式【Vのポリマーは、最高温度25℃にお いて. 95 - 96. 5重量%硫酸中に溶かす。式Vの ポリマーは、94 - 96重量%硫酸中に、好ましく は、30℃で溶かす。式VIのホモボリマーは、好まし くは、25 - 50℃において、95 - 96、5重置 10 Y=0、N=0 の組合せは、排除すべきである。 %確酸中に密かし、次に温度60 - 90℃で、スルホ ン化する。式 I のポリマーは、25℃で溶かす。実験の スルボン化は、少なくとも温度50℃、少なくとも酸濃 度98.5重量% 450,で行う。本発明に従う方法に \*

\*よって得られた芳香族ポリアリールエーテルケトンは、 殺つかの場合においては新規である。それらは、式!で 表され、ローフェニレン-〇 単位(Ar)の少なくとも 20%が50gH 基によって置換されている。P=2、M = 0. N= 0. Y= 0 及び P= 1. M= 1、X= 0、 【①022】式V!で表されるホモポリマーのスルホン 化においては、次式!! [化16]

(式中、aは0.2 - 1であり、cは0 - 0.8で あり、且つ8+c=1である)を有するスルホン酸が生 じる.

※【0023】式Vで表されるホモポリマーのスルホン化 においては、次式!!! 【化17】

(式中、aはi) - 1であり、bはi) - 1であり、c (d) = 0.5 (cab)、且(d) + (d) + (d) = (d) (d)有するスルホン酸が生じる。

【0024】スルホン化においては、一畳換生成物()

- 1であり、cは0 - 0、5である;次に、aは最 大に進し(約1)、Dは小さいままであり、cは減少す る。最後に、ジスルホン化が起こり、aの値は減少し て、bの値は増加する。

= 0)が、まず最初に得られる。この場合、8は0.5 50 【0025】反復単位の分子費は、エーテル/ケトン

特開平6-49202

15

の割合が増大すると共に増加する。故に、ポリマー! V. V、及びVIの総重量における SOLHT の割合は、 同じスルホン化度であっても異なる。例えば、スルホン 化度40%を有する式!7のスルホン化ポリエーテルケ トンは、1.25 mmol/q の SO,H 当量を有し、一方式 VIのスルホン化ポリエーテルケトンは、スルホン化度 4.0%において、SQsH当重は、わずか ()、9.4 mmol/q

【0026】スルホン化度(スルホン化された ローブ ェニルー〇 単位の割合)は、前記2つの場合において 同じであるが、物理的及び機械的性質は異なる。ポリマ 一中のケトンの割合を変化させることによって、反応性 を更に低下させることができるし、又、 望ましい種々の\* \*特性を、より選択的に確立することもできる。式Viの ポリエーテルケトンは、水溶性にせずに、極めて高いレ ベルまでスルホン化することができる。スルホン化度8 5%では、式 I Vのポリマーは、完全に水溶性である が、SQH 基を85%有する式VIのスルホン化ポリマ ーは、まだ取扱うことができるので、水から単能するこ とができる。

16

【0027】同じスルホン化度では、P=2を有する式 「のスルホン化ポリマーは、下式「Vで表されるスルホ 10 ン化ポリマーに比べて、水中で、溶けにくく且つ膨瀕し にくい。

[0028]

[1b18]

式VIのホモポリマーから誘導される式!!のスルホン 酸は、40%を超えるスルホン化度において、DMF、 硫酸に可溶性である。しかしながら、25%水酸化カリ ウム、クロロホルム、及びテトラヒドロフランには不容 性である。用いられるエーテルケトン及び得られるスル ホン酸は、少なくとも30、000の分子量を有する。 【0029】以下、実施例を掲げて、本発明を更に詳し く説明する。

[0030]

【実施例】濃度98%の濃硫酸を、滴下漏斗及び油浴を 備えている4つ口鎖控装置に入れ、そこで担々の芳香族 含有)で満定することによって、酸濃度を、98.5 - 99. 5重量% ル50、にまで調節した。次に、温度 を上昇させて、スルホン化を加速させる。最終温度は、※

※それぞれのポリマーによって左右される。表1の実験 は、式! Vのホモボリマーを用いて行った。 表2の実験 N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、及び濃 20 は、式Vのホモポリマーを用いて行った。表3の実験 は、式VIのホモポリマーを用いて行った。 哀中では、 以下の略語を用いている。

【0031】凡例

DT = 溶解温度

R温度 = 反応温度

RT = 反応時間

Y = 収率

= 25℃、造 850、中で測定した内部站 ιnh, V. 度(1).1%)

ボリエーテルケトンを溶かした。発煙罐酸(20% SO, 30 Da. sulf、= 元素分析から得られた確實含有率によっ て測定したスルホン化度(スルホン化された O-フェ ニレン-〇 単位の割合》

【表1】

轰1

	DТ	酸最終濃度	R温度	RT	Y	int. V.	Dg. sulf.
	(%)	(%)	(°C)	(時)	(%)	(d1/g)	(%)
ĺ	25	98. 50	25	1.00	> 90		40
IJ	25	98. 50	45 <b>-</b> 50 ·	L. 25	> 90	_	63
III	25	98. 50	45-50	1. 50	> 90	0. 73	66
ľV	40	98. 50	60	3. 00	> 90	0. 64	82
γ	25	98. 50	50	1.50	> 90	0.71	77
VI	25	98. 50	50	1.50	> 90	0.71	76

【表2】

50

(10)

特開平6-49202

18

<u>1</u>7

表2

	DT 酸最終	酸最終濃度	最終決定 R温度	RT	37	: -1. 1f	D - 16
			八四沙	K I	Y	ioh. V.	Dg. sulf.
	(৫)	(%)	(°C)	(時)	(%)	(d1/g)	(%)
[	30	98.50	30-35	1. 25	> 90	0. 77	50
11	30	98. 50	25-30	6, 00	> 90	0.74	60
111	30	98. 50	50	1.00	> 90	0. 76	46
IV	30	98. 20	50	4. 00	> 90	0. 67	69

【表3】

麦3

	DT	酸最終濃度	R温度	RT	Y	inh. V.	Dg. sulf.
	(℃)	(%)	(°C)	(時)	(%)	(d1/g)	(%)
I	45	98. 30	60	1.00	> 90	0.80	21
II	45	98. 30	70	0. 50	> 90	0. 80	31
III	45	98. 30	80	0, 50	> 90	0.71	52
14	45	98. 30	80	1, 50	> 90	0. 67	72
¥	45	98. 50	60	4.00	> 90	0. 80	28
VI	45	99. 10	80	4.00	> 90	0. 60	81
AII	45	99. 95	60	4.00	> 90	0.69	82
VIII	45	99. 95	80	6. 00	> 90	0. 57	75
IX	45	98. 40	80	3.00	> 90	0. 70	91
X	45	99. 10	60	1.00	> 90	0. 62	76
XI	45	99, 95	60	0. 83	> 90	0. 70	57

特開平6-49202

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成13年3月21日(2001.3.21)

【公開香号】特開平6-49202

【公開日】平成6年2月22日(1994.2.22)

【年通号数】公開特許公報6-493

【出願番号】特願平5-140894

【国際特許分類第7版】

C08G 65/48 NQU 65/49 NQW C25B 13/08 301

[FI]

C08C 65/48 NQU 65/49 NQN

Q58 13/08 301

#### 【手統鎬正書】

【提出日】平成12年6月2日(2000.6.2)

【手続請正 1 】

【補正対象書類名】明細書

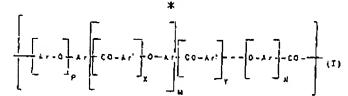
【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

\*【補正内容】

【請求項1】次式!

(化1)



(式中、A Rはパラ及び/又はメタ結合を有するフェニレン頃であり、A P はフェニレン、ナフテレン、ピフェニレン、アンスリレン、又は他の二個芳香族単位であり、X、M、及びNはそれぞれ別個にりまたは1であり、Yは0、1.2、又は3であり、Pは1、2.3、又は4であり、但しP=2、M=0、N=0、Y=0及びP=1、M=1、X=0、Y=0、N=0の組合せは除く)で表され、O-フェニレン-O単位の少なくとも20%がSO』H華で置換されている。スルホン化芳香族ポリエーテルケトンを含む高分子電解質。

※【手続稿正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

[0009]

【課題を解決するための手段】上記の目的は、次式! 【化2】

\[ \begin{align\*}
 \begin{align\*}
 & \begin{a

(式中、A はパラ及び/又はメタ結合を有するフェニレン環であり。A r はフェニレン、ナフテレン、ピフェニレン、アンスリレン。又は他の二価芳香族単位であり、X、M、及びNは、それぞれ別個に0または1であり、Yは0、1、2、又は3であり。Pは1、2、3、

又は4である)で衰される芳香族ポリエーテルケトンを スルホン化する方法、及びその結果得られる高分子電解 質によって達成されることを見出した。この方法は、議 度94-97重置%の硫酸中に芳香族ポリエーテルケ トンを溶かす工程、その得られた溶液に、硫酸の遺産が

- 續 1-

特開平6-49202

98 - 99. 5重置%になるまで、スルホン化剤を加・・・反応混合物を調製する工程、を含む。える工程、及び望ましいスルホン化度に達したら直ちに